PAT-NO:

JP361094324A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 61094324 A

TITLE:

APPARATUS FOR CORRECTING SURFACE

SHAPE OF LAMINAR PLATE

PUBN-DATE:

May 13, 1986

INVENTOR - INFORMATION: NAME

SAKAI, FUMIO ISOHATA, JUNJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

CANON INC

N/A

APPL-NO:

JP59215148

APPL-DATE:

October 16, 1984

US-CL-CURRENT: 29/25.01

## ABSTRACT:

PURPOSE: To enable the surface shape of a laminar plate to be corrected, by providing means for fixing the laminar plate, and means for deforming the laminar plate by means of a difference between air pressures.

CONSTITUTION: When a wafer 1 is disposed on a wafer chuck body 2, a vacuum is applied to a tube 3 and the wafer 1 is attractively secured to the body 2 by means of vacuum grooves 23. A pocket portion 22 whose air

pressure is controllable is thereby defined between the wafer 1 and the body 2. A driving section 7 controls the supply of a vacuum from a vacuum tube 8 or of pressurized air from a pressurized tube 9 to the pocket portion 22 in accordance with a computation output from an arithmetic circuit 12, so as to change the pressure within the pocket portion 22. Consequently, the surface shape of the wafer 1 is changed to a convex, flat or concave as required, and therefore any focus deviation between a mask and the wafer can be properly corrected.

COPYRIGHT: (C) 1986, JPO&Japio

① 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-94324

MInt Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和61年(1986)5月13日

H 01 L 21/30 G 03 F 7/20 Z-6603-5F 7124-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

回発明の名称 薄板の表面形状矯正装置

②特 願 昭59-215148

**20**出 願 昭59(1984)10月16日

⑫発 明 者 坂 井 文 夫

川崎市中原区今井上町53番地 キャノン株式会社小杉事業

所内

⑩発 明 者 磯 端 純 二

川崎市中原区今井上町53番地 キャノン株式会社小杉事業

所内

⑪出 願 人 キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

砂代 理 人 弁理士 伊東 辰雄 外1名

明 細 包含

1. 発明の名称

- 一渡板の表面形状場正装置--

# 2. 特許請求の範囲

- 1、薄板の一部を固定する固定手段と、該薄板の固定部分以外の少なくとも一部に空気圧差を適用して該薄板を変形させる手段とを具備することを特徴とする薄板の表面形状矯正装置。
- 前記固定手段が、異空圧により薄板を吸着 固定する特許請求の範囲第1項記載の薄板の表面 形状矯正を
- 3. 前記固定手段が、機械的な押付け手段により薄板を固定する特許請求の範囲第1項記載の薄板の表面形状矯正装置。
- 4、前記空気圧差を適用する手段が、前記薄板の裏面との間に間空間を形成する1つあるいは複数個に分割された凹部からなり、該閉空間の気圧を制御して大気圧との間の空気圧差を上記薄板に適用する特許請求の範囲第1、2または3項記載の薄板の表面形状矯正装置。

- 5. 前記固定手段が前記部板の周辺部を固定し、前記空気圧差を適用する手段が該薄板の中央部に空気圧差を適用する特許・請求の範囲第1~4項いまれか1つに記載の薄板の表面形状矯正装置。
- 6. 前記固定手段が前記薄板の略中心を中心と する同心円状の部分を固定し、前記空気圧差を滔 用する手段が上記薄板に対し上記各周心円状固定 部分の間で同心円状に空気圧差を適用する特許請 求の範囲第1~4項いずれか1つに記載の薄板の 表面形状矯正装置。
- 7. 前記薄板がウエハである特許請求の範囲第 1~6項いずれか1つに記載の薄板の表面形状矯正装置。
- 3. 発明の詳細な説明

[発明の分野]

本発明は、半導体ウエハ等の詩板の表面形状を 矯正する装置に関し、例えば半導体露光装置のウ エハチャックに適用されてウエハの平面度を矯正 しマスクとウエハのフォーカスずれを補正するた めに用いられる表面形状矯正装置に関する。

## [発明の背景]

一方、このような欠点を解消する目的で、ウエハ各部の真空吸着力をそれぞれ独立して調整するようにしたもの(特開昭 5 7 - 8 7 1 2 9 号、特開昭 5 7 - 1 7 7 5 3 6 号等)も堤梁されている。

正装置を提供することを目的とする。またで、ペにおいても、この表面形状矯正装置を適用することにより露光すべきウェハの表面形状をペストンメーカス面の形状に合わせてウェハの全面をあるであることが可能な表面で、状質を提供することをさらなる目的とする。 「実施例の説明」

第1図は、本発明の一実施例に係る表面形状な 正装置を適用したウェハチャックの構成を示す。

同図において、1はマスクの像が焼付けられるウェハ、2はウェハチャック本体、3はウェハ固定用吸引管(以下、チューブという)である。ウェハチャック本体2には、周辺部に関ボのウェハ支持部21を設けるとともにこのウェア成されており、10つのウェハ大・ックを持部21上に収置でより、フェハチャック本体2のウェハ支持が21上に収置

しかし、このような吸 のみによる方法では、ウェハ中央が凸形に反っている場合の矯正は比較的 好適に行なわれるものの凹形の場合は矯正が難し いという不都合が残っていた。

また、ウエハチャックとウエハとの接触面積が大きいと、間にゴミの挟まる確率が高く、この場合、ゴミの挟まった部分が凸状に持ち上ってしまうため、この部分でフォーカスずれを生じる可能性が大きいという不都合もあった。

さらに、マスクとウェハのフォーカスがウェハ面上でずれている場合すなわち光学的にペストフォーカスの位置が平面ではない場合、従来はウェハの表面形状をベストフォーカス面の形状に合わせることはできなかった。

#### [発明の目的]

本発明は、上述の従来例における問題点に揺み、ゴミを挟み込むことによるウェハの局部的な突出を防止するとともに、もとのウェハの反り方向が凹凸いずれの場合であっても、ウェハの平面度を速い追従時間で矯正することが可能な表面形状類

されたウエハ1は、真空溝 23にチューブ 3 を介して真空が印加されることによりウエハチャック本体 2 に吸着固定される。

11は駆動部7によって制御されたエアーをポケット部22に供給するチューブ(あるいは管)、12は平面度測定器10によって得られた値あるいは圧力センサ5で得られた値と指令部6から与えられ

る指令値との差分を駆動部7に動作置として与え る演算回路である。

次に、上記構成に係るウェハチャックの動作を 製品する -

ウエハ1がウエハチャック本体2に載置される と、チュープ3に真空が印加され、ウエハ1は真 空清 23によりウエハチャック本体 2 に吸着固定さ れる。これにより、ウェハ1とポケット部22の間 に空気圧の制御が可能な閉空間が形成される。こ の閉空間すなわちポケット部22は初め大気圧(1 気圧)にしてある。続いて、平面度測定器10が、 ウェハ1の表面形状例えば平面度を測定し、この 平面度測定器10の出力は演算回路12に供給される。 演算回路 12は、この平面度 初定器 10の出力と指令 部6から出力されるウェハ1の表面形状信号との 差分を演算する。駆動部7は、演算回路12の演算 出力に応じて真空チュープ8からの真空または加 圧チュープ9からの加圧空気のポケット部22への 供給を制御し、ポケット部22の圧力を変化させる。 これにより、ウエハ1のポケット部22に当面した

に駆動し表面形状を平面または所望曲率ののいいを平面または所望曲のできるようには断望はいる。 の、半導体ができるカエハの反反するでは、かったができるができる。 トフォーカスでのカエハのウェーカスができないでき、そのカオーカスができません。 クマカスができないでは、ことがでは、ないのの中央のははと接触しないに悪影響をおいる。 カステックないに悪影響をない。 もない。

# [実施例の変形例]

なお、本発明は上述の実施例に限定されることなる資宜変形して実施することができる。例えば上述の実施例において、ポケット部22は11つであったが、第2図に示すように、多数のポケット部22を設けてそれぞれにフィードバック系を接続し、ウェハ1の表面形状をウェハスの様々の位置で地正するようにすれば、より精密に表面形状矯正を行なうことができる。

部分が上または下に変位し、ウェハ 1 の表面形状が凸、平坦または凹等に変化する。以上の平面度測定ないしポケット部 22内の圧力制御動作を負別退的に繰り返すことすなわちフィードバック制御によってウェハ 1 の表面形状が指令部 6 によって与えられた形状に矯正される。

このように第1図のウェハチャックにおいては、 周辺部でのみウェハ1を支持し固定するとともに、 中央部にポケット部22を設け、このポケット部22 内の圧力を制御することでウェハの中央部を上下

# [発明の効果]

以上のように本発明によれば、ウエハ等ののおを固定するとともに他の一部に空気にて空気にできるというに反っている場合でいる。というでは、でいるのでは、でいるのでは、でいるのでは、できる。とができる。したがって、この表面形状を関で、変異を半導体のでは、変異に適用すればその露光装

個の投形系のベストフォーカス面が曲面の場合であってもウェハを所望の曲率に反らすことによりウェハ全面をフォーカス位置に設定することができる。また、薄板表面を空気圧により変位させているため、表面形状矯正のための追ע時間も速い。さらに、神板と該薄板を支持する手段との接触面積が少ないため、支持手段との間に挟まったゴミ等により、神板の表面形状が影響されることもない。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例に係るウェハチャックの概略断面図、第2図は本発明の他の実施例に係るウェハチャックの概略断面図、第3図(a)および(b)はそれぞれ本発明のさらに他の実施例に係るウェハチャックの概略断面図である。

1: ウエハ、2: ウエハチャック 本 休、21 ··· ウエハ支 持 部、22 ··· ポケット 部、23: ウエハ吸 着 用 真空 前、3: ウエハ 固定 用吸引 管、5: 圧 カ セン サ、6: 指令 部、7: 駆動 部、8: 真空 チューブ、 9:加圧チュープ、10:平面度測定器、12:演算 回路、14:押付け部、15…電気的吸着手段。

> 特許出願人 キヤノン株式会社 代理人 弁理士 伊東辰雄 代理人 弁理士 伊東哲也

